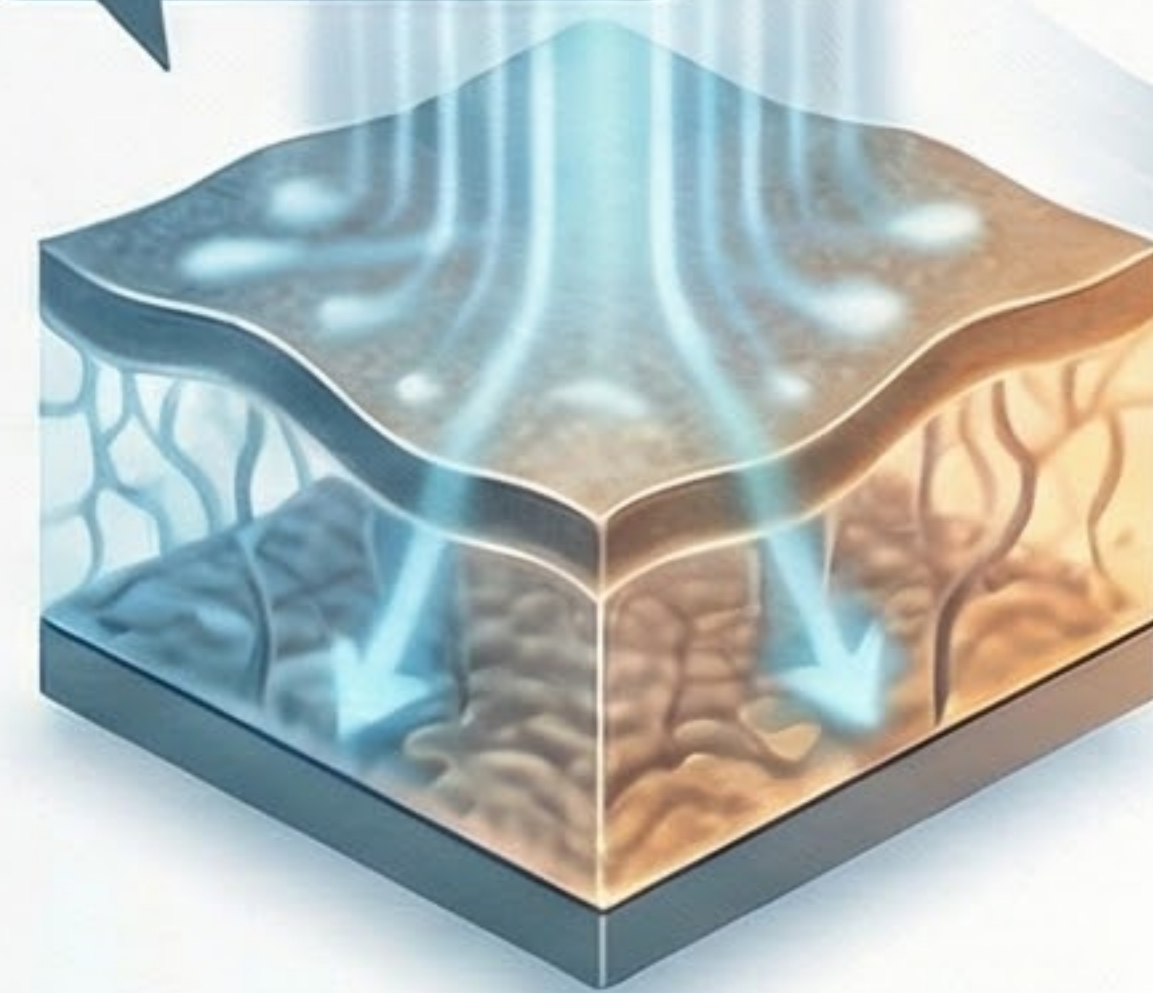


「金属」が拓く半導体の未来：次世代レジストMOR革命

パラダイムシフト：有機(CAR)から無機金属(MOR)へ

従来の有機レジスト(CAR)は物理的限界に直面
EUV光の吸収率が低く、散乱の拡散による「像のポケ」が発生する。

有機レジスト(CAR)



金属レジスト(MOR)



金属レジスト(MOR)が限界を突破

金属原子がEUV光を効率的に吸収し、酸拡散がなく高解像度を実現する。

優れたエッチング耐性

レジストの薄層化に対応し、それ自体がマスクとして機能する。

プロセス戦争とADEKAの戦略的投資

ADEKAが32億円を投資し、MOR原料の専用プラントを建設



2028年稼働予定で、次世代半導体の需要爆発期に照準を合わせる。

2028年: High-NA EUVの普及

完璧なタイミング：
2028年のロードマップ合致
新プラント稼働はHigh-NA EUVの普及と完全に同期している。

ウェット方式
(スピンオン MOR)



ドライ方式 (気相レジスト)

ウェット・ドライ両方式に供給可能で、プロセス戦争の勝敗に左右されない。

ADEKAの「全方位」戦略

材料廃棄



高 (~90% 廃棄)



低 (5-10倍少ない)

パターン倒壊リスク



中 (毛細管力)



なし (ゼロ)

インフラコスト



低 (既存再利用)



高 (新規投資)